

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016年5月19日(19.05.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/076404 A1

- (51) 国際特許分類:
G11B 5/84 (2006.01) B24B 37/20 (2012.01)
B24B 37/11 (2012.01) B24B 53/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/081903
- (22) 国際出願日: 2015年11月12日(12.11.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-229717 2014年11月12日(12.11.2014) JP
- (71) 出願人: HOYA 株式会社(HOYA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 Tokyo (JP). ホーヤ ガラスディスク タイランド リミテッド(HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.) [TH/TH]; 51000 ランブーン アンパームアン タンボルバン克蘭 ムー4 60/26 Lamphun (TH).
- (72) 発明者: カムラー サヨムプー (KHAMLAR, Sayomphu); 51000 ランブーン アンパームアン

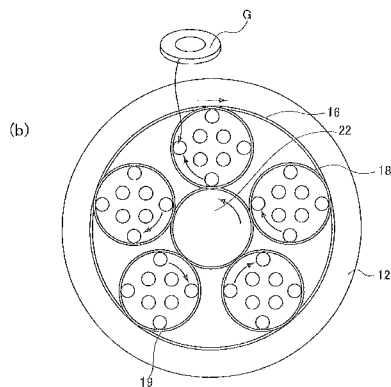
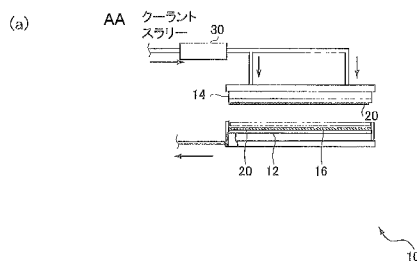
タンボルバン克蘭 ムー4 60/26
ホーヤ ガラスディスク タイランド リミ
テッド内 Lamphun (TH).

- (74) 代理人: グローバル・アイピー東京特許業務法人(GLOBAL IP TOKYO); 〒1600023 東京都新宿区西新宿8丁目3番30号 カーメル I I Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING MAGNETIC DISK SUBSTRATE AND METHOD FOR MANUFACTURING MAGNETIC DISK

(54) 発明の名称: 磁気ディスク用基板の製造方法及び磁気ディスクの製造方法



AA Coolant, slurry

(57) Abstract: A method for manufacturing a magnetic disk substrate includes a polishing process for polishing both principal surfaces of the substrate by sandwiching the substrate between a pair of suede-type polishing pads, supplying a slurry containing abrasive grains between the polishing pads and the substrate, and sliding the polishing pads and the substrate relative to each other. Before polishing of the substrate, a dressing process for removing the surface of the polishing pad is applied to the polishing pad by sliding a dresser and the polishing pad relative to each other while supplying coolant to the surface of the polishing pad provided at a surface plate. In the dressing process, the temperature or the supply amount per unit time of the coolant is controlled so that the quantity of heat removed from the polishing pad by the coolant is larger at the end point than at the start point of the dressing process.

(57) 要約: 磁気ディスク用基板の製造方法は、一対のスエードタイプの研磨パッドで基板を挟み、前記研磨パッドと前記基板の間に研磨砥粒を含むスラリーを供給して、前記研磨パッドと前記基板を相対的に摺動させることにより、前記基板の両主表面を研磨する研磨処理を含む。前記基板の前記研磨処理前、前記研磨パッドは、前記定盤に設けられた前記研磨パッドの表面にクーラントを供給しながらドレッサと前記研磨パッドを相対的に摺動させることにより、前記研磨パッドの表面を除去するドレス処理が施される。前記ドレス処理では、前記研磨パッドから前記クーラントが奪う熱量は、前記ドレス処理の開始時点よりも終了時点の方が大きくなるように前記クーラントの温度又は単位時間当たりの供給量を制御する。



MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー
ラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))